

後段金屬原子層奈米孔洞沉積系統

儀器簡介

後段金屬原子層奈米孔洞沉積系統主要功能在於沉積 TiN 薄膜，且製程厚度為 20~200Å 的薄膜。

- ❖ 全名: 後段金屬原子層奈米孔洞沉積系統
- ❖ 位置: class 10000
- ❖ 機台工程師: 邱文政 先生
- ❖ 工程師緊急聯絡電話: (O) 03-57773693 ext 7569
- ❖ 工程師代理人: 謝錦龍 先生
- ❖ 代理工程師緊急聯絡電話: (O) 03-5773693 ext 7583
- ❖ 機台使用之化學品:
 - (1) 大宗氣體: NH₃, Ar, O₂,
 - (2) 特殊氣體:
 - (3) 瓶裝化學品: 金屬有機化合物,
- ❖ 製程模式或反應腔: Thermal mode
- ❖ 反應腔真空度範圍: 5e-2 torr
- ❖ 抽真空泵浦: Dry pump
- ❖ 尾氣排放物種: C, N, O,
- ❖ 尾氣排放有無獨立之 Local Scrubber: 有, 廠務端提供
- ❖ 反應腔溫度範圍: 400°C
- ❖ 冷卻系統種類: 廠務供應冷卻水
- ❖ 其他特殊危害: 如有機化合物或氣體等等
- ❖ 製造商或代理商: 新元鋒科技股份有限公司
- ❖ 製造商工程師: Tony Huang
- ❖ 更新日期: 10 (月)/ 23 (日)/ 2024 (年)